PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-077841

(43)Date of publication of application: 23.03.1989

(51)Int.Cl.

H01J 29/07

(21)Application number: 62-232257

(71)Applicant:

HITACHI LTD

HITACHI DEVICE ENG CO LTD

(22)Date of filing:

18.09.1987

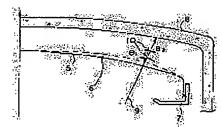
(72)Inventor:

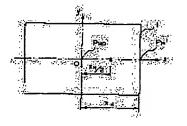
IGARASHI KOICHI NAKAMURA TAICHI

(54) COLOR CATHODE-RAY TUBE

PURPOSE: To improve the anti-doming characteristic and to increase the resolution at the center of an image screen by forming a specific pitch grading at the lateral pitch of a shadow mask.

CONSTITUTION: When the lateral pitch at the center of the image screen of a shadow mask is made PHO, and the lateral pitch at the outermost point on the X axis of the screen is made P'H, the lateral pitch grading is formed in an equation of higher degree to make the lateral pitch at the center of the screen less than (P'H-PHO)/7+PHO. As a result, the q size (the distance between panel 8 and the shadow mask 6) is made smaller, the curvature of the shadow mask 6 of the equation of higher degree is made larger at the periphery than that of a conventional quadratic equation shadow mask 5, and the discrepancy angle θ(θ1>θ2) of the incident direction of electron beam 9 and the doming direction 10 of the shadow mask can be made smaller. As a result, the transfer amount on the panel 8 when the shadow mask doming is generated by the thermal expansion can be reduced much more. .





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-77841

@Int CI.4 H 01 J 29/07

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和64年(1989) 3月23日

A-6680-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称

カラーブラウン管

创特 顧 昭62-232257

頤 四62(1987)9月18日 田の

個発 明 者 五十岁

千葉県茂原市早野3681番地 日立立デバイスエンジニアリ

ング株式会社内

の発 蚏 者 中村

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

の出願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田較河台4丁目6番地

日立デバイスエンジニ 印出 願人

千葉県茂原市早野3681番地

アリング株式会社

の代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

1. 発明の名称

カラーブラウン管

2. 特許請求の範囲

1. シャドウマスクを備えたカラープラウン程に おいて、シャドウマスクの画面中央の様ピッチ を Pao、西面×帕上の最外点の間ピッチを Pao とした時、画面中間部の後ピツチが (P's-Pno) /2 + Pm より小さくなるように、様ピツチグ レーデイングを高次式で形成したことを特徴と するカラーブラウン質。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はカラーブラウン管に低り、特にパネル 内に装着したシャドクマスクに関する。

〔従来の技術〕

花来、シャドウマスクの西西中央の横ビツチよ り画面周辺の棋ピンチを大きくすることにより、 周辺のシャドウマスク田準を大きくして、またビ ユリティ裕度を増して、ドーミング対策すること

が、株式会社はCAよりシャドウマスクのパリア ブルピツチとして複楽されている。

従来のペリアブルビツチは2次式となつており、 第3図に示す有効質1の過 面中央の機ピッチをPao とすると、シャドウマスタのスロツト活致れる機 ピッチPa及びエ軸座はXは次式で収わされる。

 $P_{n}(n) = P_{no} \times \{1 + (n-1)^{2} \cdot \alpha\}$

 $X(n) = P_{no} \times \{n+n-(n-1) \cdot (2n-1) \cdot a/6\}$

ただし、4はパリアブルビツチ率により央る定 数である。

この場合の順面中内部 XM2の機ピツチは、瞬面 周辺 XHの棋ピッチを P'Rとすると、(P's-Pm)/4 + Pro となつている。

[発明が解決しようとする問題点]

上配従来技術でもドーミング対策となるが、更 にドーミング特性を向上させることが強く要因さ れている。

本発明の目的は、より一層と一ミング特性の向 上を図ることができるカラーブラウン質を提供す ることにある。

特開昭64-77841(2)

【問題点を解決するための手段】

上記目的は、シャドウマスタの画面中央の様ピッチをPax、画面×船上の最外点の様ピッチをPaxとした時、画面中間部の様ピッチが(Pla-Pax)ノッキPaxより小さくなるように、様ピッチグレーディングを高次式で形成することにより込成される。

〔作用〕

シャドウマスクの袋ピツチに、高次式に従った ピツチグレーディングを付けることにより、適正 中間部付近の袋ピンチを小さくできる。

されにより、シャドウマスク中間部の q 寸法(パネルとシャドウマスクの距離)は小さくなり、 画面扇辺部でのシャドウマスク曲率が大きくできる。シャドウマスク囲辺部でのシャドウマスク曲率が大きくなると、電子ピームの入射方向とシャ ドウマスクのドーミング方向のずれ角度が小さく できるので、無応設によるシャドウマスクドーミ ングが緑つた時のパネル上でのピーム移動量を低 域できる。

数である。

この場合の歯菌中間部 xxxの換ピッチは、透面 周辺 xxの模ピッチを P's とすると、約(P's-Pm) /8 + Pso となる。

前記4次式パリアブルビッチ4の場合の模ピッチPa及び×軸路様Xは次式で設わされる。

 $P_{\theta}(n) = P_{\theta \theta} \times \{1 + (n-1)^{\theta} \cdot \theta\}$

 $X(n) = 1' \times (n+n) \cdot (n-1) \cdot (2n-1) \cdot (3n^2 - n^2)$

3n-1) · a/301

この場合の画面中間部 28/4 の模ピッチは、 約 (P'a - Pao)/16 + Pao となる。

このように、高次文に従つたパリアブルピッチ
3、4とするととにより、画面中間部 x extの様ピッチは前記したように小さくなる。これは第1図によつても明らかである。これにより、シャドウマスタ中間部の q 寸法くパネル 8 とシャドウマスク 6 の単離)は小さくなり、第2図に示すように、従来の2次式シャドウマスク 5 の曲 率よりも高次次のシャドウマスク 6 の曲 24は、周辺部で大きくなる。このようにシャドフマスク周辺部でのシャ

(突旌例)

以下、本発明の一実施例を第1個万盃第3回により説明する。第1回において、実験2は便楽の2次式パリアブルピッチ、一点遊殷3は本場明の一支施例である3次式パリアブルピッチ、点線4は本発明の他の実施例である4次式パリアブルピッチを示す。また第2四において、 実施で示したシャドウマスク5は、従来の2次式のパリアブルピッチ2の曲率を示し、点線で示すシャドウマスクらは、本発明の高次式のパリアブルピッチ3または4の曲率を示す。なお、7はシャドウマスク5または6が固定されたサポートフレーム、8はパネルである。

南記3次式パリアブルピツチ3は、第3図に示す有効面1の扇面中央の機ピツチを Pao とすると、シャドウマスクものスロウト毒酸 R と幅ピツナ PR 及び x 機器様 X は次大で扱わされる。

 $P_{H}(n) = P_{H0} \times \{1+(n-1)^{4} \cdot \alpha\}$

 $X(n) = P_{n0} \times \{n+n^2 \cdot (n-1)^2 \cdot \alpha/4\}$

ただし、ロはパリアブルピツチ選により吹る定

とのように、ドーミング方向のずれ角度が成米 より小さくできるので、熱酸機によるシャドウマ スクドーミングが起つたときのパネル8上でのビ ーム移動量を一層低級できる。

なお、上記映施例においては、吹ビッチグレーディングを高次式とし、適価中間部の領ピッチが $(P'n-P_{ED})/8$ $+P_{ED}$ 以下になるように形成した 場合について説明したが、指干のはらつきを考慮した場合、適面中脳部の機ピッチが $(P'a-P_{ED})/2$ $+P_{ED}$ 以下でも良い。

【発明の効果】

本発明によれば、対ドーミング特性が向上し、 また歯質中間部での解像度を従来より上げるとと もできる。

4. 図面の簡単な説明

特別昭64-77841(3)

第1回はシャドウマスクの例ピッチとスロット 誘数の関係を示す図、第2回は質染のシャドウマ スク曲率と本鋭明になるシャドウマスク曲率との 比較を示す説明図、第3回はけいた可上の位置と 様ピッチとの定義を示す説明図である。

2… 2 次式パリアプルピンチ、 3… 3 次式パリアプルピンチ、 4… 4 次式パリアプルピンチ、 5… 従来のシャドウマスク曲路、 6 … 本籍明のシャドウマスク曲器。

代理人 弁理士 小 川 粉 坍



